## 2013 No.02 TOKYO DYLEC 社内レポート

- Instrument Performance test -

## <u>LiquiScan-ES(液中ナノ粒子計測システム)を用いた</u> <u>金コロイドナノ粒子の計測例</u>



東京ダイレック株式会社 〒160-0015 東京都新宿区内藤町1内藤町ビルディング TEL 03(3355)3632 (代) FAX 03(3353)6895 営業部 宮本 高志 技術部 船戸 浩二、濱 尚矢、中村 馨 E-maill info@tokyo-dylec.co.jp URL http://www.t-dylec.net/

- 概要: 昨今の急速なナノテクノロジー開発に伴い、多種多様なナノ材料が多くの分野で利用され、 今日では特殊な加工製品から日用品まで幅広く使われるようになった。金コロイドナノ粒子も 有益なナノ材料の一つで、優れた独特の光学特性や粒径の均一性を有することから多くの ハイテク分野に活用されており、用途に応じた異なるサイズの金ナノ粒子が製品化されている。 米国のTSI社はコロイドナノ粒子の粒径分布を短時間に計測する装置としてLiquiScan-ES (液中ナノ粒子計測システム、モデル3980)を製品化しており、従来の光散乱検出装置では 困難であった高分解能での粒径分布解析を可能にしている。LiquiScan-ESは、粒子を発生する エレクトロスプレー(モデル3480)と粒径分布を計測するSMPS(モデル3936)で構成されている。 今回の試験では、粒径の異なる5種類の金コロイドナノ粒子でも同様の試験を行った。
- 試験日時: 2013年10月17日(木)~18日(金)
- 前処理: 金ナノ粒子を含む試料溶液中には、還元剤などの溶剤が含まれており、粒子を発生する際に これらの溶剤がより大きなピークとなって現れたり、蒸発残渣として金ナノ粒子の粒径値に影響 することがある。これらの影響を軽減するため、事前に試料をミクロ遠心機(モデルMCD-2000)で 遠心分離し、上澄みを除去する。また必要に応じてバッファ液で希釈する。
- 試験方法: 下記フロー図が示すように、エレクトロスプレーにて発生したコロイドナノ粒子の粒径分布を SMPSで計測する。



試験機器:
①モデル:3480 エレクトロスプレー(発生器) TSI社製
発生流量:1.5LPM
試料溶液:金粒子 10、30、50、100、200nm Cytodiagnostics社製
シリカ粒子 30、50、100nm Micromod社製

 ②モデル:3936NL75 SMPS(粒径分布計測器) TSI社製 サンプル流量:0.3LPM シース流量:3.0LPM 粒径範囲:4.6~156.8nm(Nano-DMA)、17.5~532.8nm(Long-DMA) 計測時間:60秒
③モデル:MCD-2000 ミクロ遠心機 アズワン社製

回転数:14,000rpm 運転時間:20分間

試験結果:

| No | 試料    | 粒径(nm) | LiquiScan-ESで <b>のモー</b> ド径(nm) | その他                       |
|----|-------|--------|---------------------------------|---------------------------|
| 1  | 金粒子   | 10     | 10.2                            | Nano-DMA使用<br>バッファ液で2倍希釈  |
| 2  | 金粒子   | 30     | 25.0                            | Nano-DMA使用                |
| 3  | 金粒子   | 50     | 46.1                            | Nano-DMA使用                |
| 4  | 金粒子   | 100    | 101.8                           | Long-DMA使用                |
| 5  | 金粒子   | 200    | 201.7                           | Long-DMA使用                |
| 6  | シリカ粒子 | 30     | 30.0                            | Nano-DMA使用<br>バッファ液で3倍希釈  |
| 7  | シリカ粒子 | 50     | 46.1                            | Nano-DMA使用<br>バッファ液で5倍希釈  |
| 8  | シリカ粒子 | 100    | 109.4                           | Long-DMA使用<br>バッファ液で10倍希釈 |

## <遠心分離処理の効果(金粒子50nm)>

遠心分離前



遠心分離を約20分間行う

金粒子が下に溜まっているのが見える

遠心分離後



※発生時は上澄み液を1/2程度取り除き使用











